PAT-NO:

JP02003082012A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2003082012 A

TITLE:

METHOD FOR PRODUCING CROSS-LINKED POLYELECTROLYTE AND

CROSS-LINKED POLYELECTROLYTE

PUBN-DATE:

March 19, 2003

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OKANIWA, MOTOKI

N/A

GOTO, KOHEI

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

JSR CORP

N/A

APPL-NO:

JP2001275421

APPL-DATE:

September 11, 2001

INT-CL (IPC): C08F002/44, C08F283/00, H01B001/06, H01B013/00, H01M008/02

. H01M008/10

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cross-linked polyelectrolyte having excellent permanency and useful as a proton conductive membrane such as an electrolyte for primary batteries, an electrolyte for secondary batteries, a solid polyelectrolyte for fuel cells, a display element, various kinds of sensors, a signal transmission medium, a solid capacitor or an ion exchange membrane while maintaining essentially possessed high proton conductivity.

SOLUTION: This cross-linked polyelectrolyte having a high cross-linking density is produced by subjecting a monomer having at least ≥2 radically polymerizable groups in one molecule to a polymerizing reaction in the presence of a proton conductive polymer.

COPYRIGHT: (C)2003, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-82012 (P2003-82012A)

(43)公開日 平成15年3月19日(2003.3.19)

(51) Int.Cl.7	t.Cl.' 戴別記号 F I		テーマコード(参考)		
C08F 2/44		C08F 2/44	C 4J011		
283/00		283/00	4 J 0 2 6		
H 0 1 B 1/06		H 0 1 B 1/06	A 5G301		
13/00		13/00	Z 5H026		
// H 0 1 M 8/02		H 0 1 M 8/02	P		
	審査請求	未請求 請求項の数8 OL	(全 19 頁) 最終頁に続く		
(21)出願番号	特願2001-275421(P2001-275421)	(71)出願人 000004178			
		ジェイエスフ	ール株式会社		
(22)出顧日	平成13年9月11日(2001.9.11)	東京都中央区築地2丁目11番24号			
		(72)発明者 岡庭 求樹	•		
		東京都中央区	【築地二丁目11番24号 ジェイ		
	·	エスアールを	社会社内		
		(72)発明者 後藤 幸平			
		東京都中央区	【築地二丁目11番24号 ジェイ		
		エスアールを	式会社内		
		(74)代理人 100084308			
		弁理士 岩見	谷 周志		
- 2					
			最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 架橋高分子電解質の製造方法および架橋高分子電解質

(57)【要約】

【課題】 本来有する高いプロトン伝導性を維持しつつ、かつ恒久性に優れた高分子電解質を提供することを目的とする。一次電池用電解質、二次電池用電解質、燃料電池用高分子固体電解質、表示素子、各種センサー、信号伝達媒体、固体コンデンサー、イオン交換膜などのプロトン伝導膜として有用なものを提供する。 【解決手段】 プロトン伝導性ポリマーの存在下に、一分子中に少なくとも2つ以上のラジカル重合性基を有するモノマーを重合反応させることにより高架橋密度の架橋高分子電解質を製造する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 プロトン伝導性ポリマーの存在下に、1 分子中に少なくとも2つ以上のラジカル重合性基を有す るモノマーを重合反応させることを特徴とする架橋高分 子電解質の製造方法。

【請求項2】 前記2つ以上のラジカル重合性基が、同一または異なり、アクリロイル基またはメタクリロイル基であることを特徴とする請求項1記載の架橋高分子電解質の製造方法。

【請求項3】 前記プロトン伝導性ポリマーが、スルホ 10 ン化ポリアリーレンであることを特徴とする請求項1,*

法。 【請求項5】 前記単位(a)が、下記一般式(a2) で表される単位であることを特徴とする請求項4記載の

(a) 主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物単位を

含むポリアリーレン系重合体のスルホン化物であること

を特徴とする請求項3記載の架橋高分子電解質の製造方

【請求項4】 前記スルホン化ポリアリーレンが、

* 2記載の架橋高分子電解質の製造方法。

架橋高分子電解質の製造方法。

(化1)

··· (a2)

(一般式 (a2) 中、Aは独立に電子吸引性の基であり、Bは独立に電子供与性の原子又は2価の基であり、 $R^1 \sim R^8$ は、同一または異なり、水素原子、フッ素原 20子、アリル基、アルキル基またはフルオロアルキル基であり、nは2以上の整数である。)

【請求項6】 前記ポリアリーレン系重合体が、

(a)主鎮に電子吸引性基を有する芳香族化合物単位 と、(b)主鎖に電子吸引性基を有しない芳香族化合物 単位とを含むポリアリーレン系共重合体であることを特 徴とする請求項4記載の架橋高分子電解質の製造方法。

【請求項7】 前記単位(a)が、下記一般式(a1) および(a2)で表される単位からなる群から選ばれる少なくとも1種の単位であり、かつ、前記単位(b)が、下記一般式(b1)~(b4)で表される単位からなる群から選ばれる少なくとも1種の単位であることを※

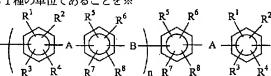
※特徴とする請求項6記載の架橋高分子電解質の製造方法。

20 R^1 R^2 R^5 R^6 $R^{1'}$ $R^{2'}$ $R^{5'}$ $R^{6'}$ $R^{6'}$ $R^{1'}$ $R^{2'}$ $R^{5'}$ $R^{6'}$ $R^{1'}$ $R^{1'}$

... (a1)

(一般式(a1)中、 Aは独立に電子吸引性基であり、R¹~R®およびR¹'~R®'は、同一または異なり、水素原子、フッ素原子、アリル基、アルキル基またはフルオロアルキル基であり、rは0または1の整数である。)

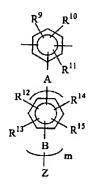
【化3】



··· (a2)

(一般式(a2)中、Aは独立に電子吸引性の基であり、Bは独立に電子供与性の原子又は2価の基であり、 $R^1 \sim R^8$ は、同一または異なり、水素原子、フッ素原子、アリル基、アルキル基またはフルオロアルキル基であり、nは2以上の整数である。)

***** 0



... (b1)

50 (一般式(b1)中、Aは電子吸引性の基であり、Bは

... (D 1 ,

8/27/07, EAST Version: 2.1.0.14

独立に電子供与性の原子または2価の基であり、R⁹~R¹⁵は、同一または異なり、水素原子、フッ素原子、アリル基、アルキル基またはフルオロアルキル基であり、Zはアリール基であり、mはO、1または2の整数である。)

【化5】

... (b2)

【化6】

···(b3)

【化7】

... (b4)

(上記一般式(b2)~(b4)中、R¹⁷~R²⁴は、同 30 一または異なり、水素原子、フッ素原子、アリル基、アルキル基またはフルオロアルキル基である。)

【請求項8】N-メチルピロリドンへの不溶分が40重量%以上であることを特徴とする請求項1~7のいずれか一項記載の製造方法により得られた架橋高分子電解質。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高耐久性固体高分子電解質に関し、さらに詳しくは、高分子電解質型燃料 40電池や水電解セルなどの固体高分子電解質膜などに好適に用いられる耐酸化性に優れた高耐久性固体高分子電解質およびその製法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】固体高分子電解質は、高分子鎖中にスルホン酸基やカルボン酸基等の電解質基を有する固体高分子材料であり、特定のイオンと強固に結合したり、陽イオン又は陰イオンを選択的に透過する性質を有していることから、高分子電解質型燃料電池や水電解セルにおける高分子電解質膜として利用される。

【0003】高分子電解質型燃料電池は、プロトン伝導性の固体高分子電解質膜の両面に一対の電極を設け、純水素あるいは改質水素ガスを燃料ガスとして一方の電極(燃料極)へ供給し、酸素ガスあるいは空気を酸化剤として異なる電極(空気極)へ供給し、起電力を得るものである。また、水電解は、固体高分子電解質膜を用いて水を電気分解することにより燃料電池反応の逆反応が起こり水素と酸素を製造するものである。

【0004】しかしながら、実際の燃料電池や水電解ではこれらの主反応の他に副反応が起こる。その代表的なものが過酸化水素(H2O2)の生成である。この過酸化水素(H2O2)の生成には、水素極では、ガス中に不純物としてあるいは意図的に混ぜることによって混入している酸素、もしくは酸素極で電解質にとけ込み水素極に拡散してきた酸素が反応に関与すると考えられ、一方、水電解でもほぼ同様に過酸化水素(H2O2)を生成する副反応が起こりうる。

【0005】そして、これらの電極上で発生した過酸化水素は、電極から拡散等により離反して、電解質中に移動する。この過酸化水素は酸化力の強い物質であるため、電解質を構成する多くの有機物を酸化する。その詳しいメカニズムは必ずしも明らかになっていないが、多くの場合、過酸化水素がラジカル化し、生成した過酸化水素ラジカルが酸化反応の直接の反応物質になっていると考えられる。

【0006】特開2001-118591号公報では、高分子電解 質の耐久性を向上させるために、電池反応によって発生 する過酸化物に対する耐酸化性に優れた高耐久性高分子 電解質が開示されている。該公報では、具体的には高分 子電解質中に過酸化物を接触分解する触媒能を有する遷 移金属酸化物を分散配合するか、過酸化物の分解を抑制 する金属過酸化物などの過酸化物安定剤を分散配合する か、フェノール性水酸基を電解質高分子に化学結合によ り導入するかの少なくともいずれかの手段をとってい る。しかし、金属過酸化物を高分子電解質中に配合する と、極端に膜強度が低下するため、高分子電解膜を用い て燃料電池を実際に作成する際の取り付け作業時等に高 分子電解膜が破れたりする重大な問題点が発生する。ま た、フェノール性水酸基を電解質高分子に化学結合によ り導入する方法により高いラジカル耐性を発現するには 非常に多くのフェノール性水酸基の導入が必要であり、 高分子電解質のプロトン伝導度が低下する致命的な問題 が発生するため、高いプロトン導電性を維持しながら高 いラジカル耐性および強靱なフィルム強度を維持する方 法は限界があり、まだ不十分であった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、本来有する 高いプロトン伝導性を維持しつつ、かつ恒久性に優れた 高分子電解質を提供することを目的とするものである。 50 【0008】

8/27/07, EAST Version: 2.1.0.14

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解決するため、プロトン伝導性ポリマーの存在下に、1分子中に少なくとも2つ以上のラジカル重合性基を有するモノマーを重合反応させて架橋高分子電解質を製造する方法に関するものである。また、この製造方法によって得られた、N-メチルピロリドンへの不溶分が40重量%以上である架橋高分子電解質自体に関するものである。

【0009】1. [プロトン伝導性ポリマー] プロトン伝導性ポリマーは、電解質基と炭化水素部とを有するものであって、電解質基としては、スルホン酸基、カルボン酸基等のイオン形成性官能基が挙げられる。さらに、プロトン伝導性ポリマーの炭化水素部には、電解質基を導入することが可能な部分に対し、前記電解質基が所定の導入率で導入されている。

【0010】上記電解質基が導入される炭化水素部を有する高分子化合物の具体例としては、ポリアリーレンスルホン樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリエーテルエーテルとド樹脂、直鎖型フェノールーホルムアルデヒド樹脂、東橋型フェノールホルムアルデヒド樹脂、直鎖型ポリスチレン樹脂、架橋型ポリスチレン樹脂、直鎖型ポリスチレン樹脂、水間(2,3・ジフェニルー1,4・フェニレンオキシド)樹脂、ポリ(アリルエーテルケトン)樹脂、ポリ(アリーレンエーテルスルホン)樹脂、ポリ(フェニルキノサンリン)樹脂、ポリ(ベンジルシラン)樹脂、ポリスチレンーグラフトーエチレンテトラフルオロエチレン樹脂、ポリスチレンーグラフトーポリフッ化ビニリデン樹脂、ポリスチレンーグラフトーテトラフルオロエチレン樹脂等が挙げられる。

【0011】本発明においては、好ましくは、プロトン 30 伝導性ポリマーとしてスルホン化ポリアリーレンが用い られる。また、プロトン伝導性ポリマー中にラジカル反 応性基を有すると、本発明で用いる1分子中に少なくと も2つ以上のラジカル重合性基を有するモノマーの使用 量が少なくても、N-メチルピロリドンの不溶分が多い 架橋高分子電解質が得られるので好ましい。該ラジカル 反応性基としては、フリーラジカルにより容易に水素原 子が引き抜かれる3級炭素を有するアルキル基(具体 例:イソプロピル基)、アリール基、ビニル基、メルカ プト基、アクリロイル基、メタクリロイル基などを挙げ 40 ることができる。特に、3級炭素を有するアルキル基の 場合は、スルホン化後もこの3級炭素を有するアルキル 基がポリマー中に残存しやすいため、架橋反応点として 効率よくこの官能基が作用し、より高度に架橋した架橋 高分子電解質が得られるため好ましい。

【0012】スルホン化反応前のポリアリーレンとしては、(a)主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物単位(以下、単位(A)という)を含むポリアリーレン系重合体であることが、上記単位(A)により主鎖中に屈曲性構造を有するために靭性が高く、好ましい。

【0013】また、上記単位(A)と、(b)主鎖に電子吸引性基を有しない芳香族化合物単位(以下、単位(B)という)とを含むポリアリーレン系共重合体であることが、単位(B)によりスルホン酸基の導入上限量を制御でき、スルホン化しても靭性および耐熱水性が低下しにくく、靭性、機械的強度、弾性率、抗膨潤性に優れたものであるので、よりこのましい。

【0014】(1)単位(A)を構成するモノマー単位(A)を構成するモノマー(以下、「モノマー(A)」という)として、好ましくは、下記一般式(a1-1m)、(a1-2m)および(a2m)で表されるものモノマー(以下、順に「モノマー(A1)」、「モノマー(A2)」、「モノマー(A3)」という)が挙げられる。

[0015]

【化8】

$$X \xrightarrow{R^1} R^2 \xrightarrow{R^5} R^6 \times X$$

 \cdots (a 1 - 1 m)

(一般式(a1-1m)中、Xは独立に塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子または $-OSO_2Y$ (ここで、Yはアルキル基、ハロゲン化アルキル基またはアリール基を示す)であり、Aは電子吸引性基であり、 $R^1 \sim R^8$ は、同一または異なり、水素原子、フッ素原子、アリル基、アルキル基またはフルオロアルキル基である。)

【0016】上記一般式(a1-1m)中、電子吸引性 基(A)としては、-CO-、-CONH-、-(CF 2)p-(ここで、pは1~10の整数である)、-C (CF₃)₂-、-COO-、-SO-、-SO₂-など が挙げられる。

【0017】同じく、上記アルキル基としては、メチル基、エチル基、イソプロビル基などが、フルオロアルキル基としては、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基などが挙げられる。3級炭素を有するイソプロピル基などは、架橋反応の際の架橋点として作用し、効率よく架橋反応が起こるためこのましい。

40 【0018】おなじく、-OSO2Y中のZとしては、 アルキル基としてメチル基、エチル基などが、ハロゲン 化アルキル基としてトリフルオロメチル基、ペンタフル オロエチル基などが、アリール基としてフェニル基、p -トリル基などが挙げられる。

【0019】上記モノマー(A1)の具体例を次にしめす。(A1-1)4,4'-ジクロロベンゾフェノン、2,4'-ジクロロベンゾフェノン、4,4'-ジブロモベンゾフェノン、2,4'-ジブロモベンゾフェノン、4,4'-ジョード
50 ベンゾフェノン、2,4'-ジョードベンゾフェノン、3,3'-

ジョードベンゾフェノン、ビス(4-トリフルオロメチル スルフォニロキシフェニル)ケトン、ビス(3-トリフルオ ロメチルスルフォニロキシフェニル)ケトン。

【0020】(A1-2) 4,4'-ジクロロベンズアニリド、3, 3'-ジクロロベンズアニリド、3,4'-ジクロロベンズアニ リド、4,4'-ジブロモベンズアニリド、3,3'-ジブロモベ ンズアニリド、3,4'-ジブロモベンズアニリド、4,4'-ジ ヨードベンズアニリド、3,3'-ジョードベンズアニリ ド、3,4'-ジョードベンズアニリド。

【0021】(A1-3) ビス(クロロフェニル)ジフルオロ メタン、ビス(クロロフェニル)テトラフルオロエタン、 ビス(クロロフェニル)ヘキサフルオロプロパン、ビス (クロロフェニル)オクタフルオロブタン、ビス(クロロ フェニル)デカフルオロペンタン、ビス(クロロフェニ ル)ドデカフルオロヘキサン、ビス(クロロフェニル)テ トラデカフルオロヘプタン、ビス(クロロフェニル)へキ サデカフルオロオクタン、ビス(クロロフェニル)オクタ デカフルオロノナン、ビス(クロロフェニル)エイコサフ ルオロデカン、ビス(ブロモフェニル)ジフルオロメタ ン、ビス(ブロモフェニル)テトラフルオロエタン、ビス 20 (ブロモフェニル)ヘキサフルオロプロパン、ビス(ブロ モフェニル)オクタフルオロブタン、ビス(ブロモフェニ ル) デカフルオロペンタン、ビス(ブロモフェニル) ドデ カフルオロヘキサン、ビス(ブロモフェニル)テトラデカ フルオロヘプタン、ビス(ブロモフェニル)へキサデカフ ルオロオクタン、ビス(ブロモフェニル)オクタデカフル オロノナン、ビス(ブロモフェニル)エイコサフルオロデ カン、ビス(ヨードフェニル)ジフルオロメタン、ビス (ヨードフェニル)テトラフルオロエタン、ビス(ヨード フェニル)ヘキサフルオロプロパン、ビス(ヨードフェニ 30 ル)オクタフルオロブタン、ビス(ヨードフェニル)デカ フルオロペンタン、ビス(ヨードフェニル)ドデカフルオ ロヘキサン、ビス(ヨードフェニル)テトラデカフルオロ ヘプタン、ビス(ヨードフェニル)ヘキサデカフルオロオ クタン、ビス(ヨードフェニル)オクタデカフルオロノナ ン、ビス(ヨードフェニル)エイコサフルオロデカン。

【0022】(A1-4) 2,2-ビス(4-クロロフェニル)へキ サフルオロプロパン、2,2-ビス(3-クロロフェニル)へキ サフルオロプロパン、2,2-ビス(4-ブロモフェニル)へキ サフルオロプロパン、2,2-ビス(3-ブロモフェニル)へキ サフルオロプロパン、2,2-ビス(4-ヨードフェニル)へキ サフルオロプロパン、2,2-ビス(3-ヨードフェニル)へキ サフルオロプロパン、ビス(4-トリフルオロメチルスル フォニロキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン、ビス (3-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)へキ サフルオロプロパン。

【 0 0 2 3 】 (A1-5) 4-クロロ安息香酸-4-クロロフェニ ル、4-クロロ安息香酸-3-クロロフェニル、3-クロロ安 息香酸-3-クロロフェニル、3-クロロ安息香酸-4-クロロ フェニル、4-ブロモ安息香酸-4-ブロモフェニル、4-ブ 50 イルアミ)ジフェニルエーテル、4,4'-ビス(3-クロロベ

ロモ安息香酸-3-ブロモフェニル、3-ブロモ安息香酸-3-ブロモフェニル、3-ブロモ安息香酸-4-ブロモフェニル (A1-6) ビス(4-クロロフェニル)スルホキシド、ビス(3-クロロフェニル)スルホキシド、ビス(4-ブロモフェニ ル)スルホキシド、ビス(3-ブロモフェニル)スルホキシ ド、ビス(4-ヨードフェニル)スルホキシド、ビス(3-ヨ ードフェニル)スルホキシド、ビス(4-トリフルオロメチ ルスルフォニロキシフェニル)スルホキシド、ビス(3-ト リフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)スルホキ 10 シド。

【0024】(A1-7) ビス(4-クロロフェニル)スルホ ン、ビス(3-クロロフェニル)スルホン、ビス(4-ブロモ フェニル)スルホン、ビス(3-ブロモフェニル)スルホ ン、ビス(4-ヨードフェニル)スルホン、ビス(3-ヨード フェニル)スルホン、ビス(4-トリフルオロメチルスルフ ォニロキシフェニル)スルホン、ビス(3-トリフルオロメ チルスルフォニロキシフェニル)スルホン。

[0025]

【化9】

$$R^{1}$$
 R^{2} R^{5} R^{6} $R^{1'}$ $R^{2'}$ $R^{5'}$ $R^{6'}$ $R^{5'}$ $R^{6'}$ $R^{7'}$ $R^{8'}$ $R^{7'}$ $R^{8'}$

 \cdots (a 1 - 2 m)

(一般式 (a1-2m) 中、X、R1~R8は、式 (a1 -1m)に関して定義したとおりであり、Aは独立に式 (a1-1m)に関して定義したとおりの電子吸引性基 であり、 $R^{1'} \sim R^{8'}$ は、同一または異なり、水素原子、 フッ素原子、アリル基、アルキル基またはフルオロアル キル基である。)

上記一般式 (a1-2m) 中のアルキル基、フルオロア ルキル基としては、一般式(a1-1m)に関して定義 したとおりのものである。

【0026】上記モノマー(A2)の具体例を次にしめ す。(A2-1) 4,4'-ビス(4-クロロベンゾイル)ジフェニル エーテル、4,4'-ビス(3-クロロベンゾイル)ジフェニル エーテル、4,4'-ビス(4-ブロモベンゾイル)ジフェニル エーテル、4,4'-ビス(3-ブロモベンゾイル)ジフェニル エーテル、4,4'-ビス(4-ヨードベンゾイル)ジフェニル エーテル、4,4'-ビス(3-ヨードベンゾイル)ジフェニル エーテル、4,4'-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニ ロキシフェニル) ジフェニルエーテル、4,4'-ビス(3-ト リフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)ジフェニ ルエーテル、4,4'-ビス(4-メチルスルフォニロキシフェ ニル) ジフェニルエーテル、4.4'-ビス(3-メチルスルフ オニロキシフェニル)ジフェニルエーテル。

【0027】(A2-2) 4.4'ービス(4-クロロベンゾイルア ミノ) ジフェニルエーテル、3,4'-ビス(4-クロロベンゾ

ンゾイルアミノ)ジフェニルエーテル、3,4'-ビス(3-ク ロロベンゾイル) ジフェニルエーテル、4,4'-ビス(4-ブ ロモベンゾイルアミノ)ジフェニルエーテル、3,4'-ビス (4-ブロモベンゾイルアミノ)ジフェニルエーテル、4,4 -ビス(3-ブロモベンゾイルアミノ)ジフェニルエーテ ル、3.4'-ビス(3-ブロモベンゾイルアミノ)ジフェニル エーテル、4,4'-ビス(4-ヨードベンゾイルアミノ)ジフ ェニルエーテル、3.4'-ビス(4-ヨードベンゾイルアミ ノ) ジフェニルエーテル、4,4'-ビス(3-ヨードベンゾイ ルアミノ)ジフェニルエーテル、3.4'-ビス(3-ヨードベ ンゾイルアミノ) ジフェニルエーテル、4,4'-ビス(4-ト リフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)ジフェニ ルエーテル、3,4'-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォ ニロキシフェニル)ジフェニルエーテル、4,4'-ビス(3-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)ジフェ ニルエーテル、3.4'-ビス(3-トリフルオロメチルスルフ ォニロキシフェニル)ジフェニルエーテル、4,4'-ビス(4 -メチルスルフォニロキシフェニル)ジフェニルエーテ ル、3,4'-ビス(4-メチルスルフォニロキシフェニル)ジ フェニルエーテル、4,4'-ビス(3-メチルスルフォニロキ 20 シフェニル) ジフェニルエーテル、3,4'-ビス(3-メチル スルフォニロキシフェニル)ジフェニルエーテル。 【0028】(A2-3) 4,4'-ビス(4-クロロフェニルスル ホニル)ジフェニルエーテル、3,4'ービス(4-クロロフェ ニルスルホニル) ジフェニルエーテル、4.4'-ビス(3-ク ロロフェニルスルホニル) ジフェニルエーテル、3,4'-ビ ス(3-クロロフェニルスルホニル)ジフェニルエーテル、 4,4'-ビス(4-ブロモフェニルスルホニル)ジフェニルエ ーテル、3,4'ービス(4-ブロモフェニルスルホニル)ジフ ェニルエーテル、4,4'-ビス(3-ブロモフェニルスルホニ 30 ート。 ル) ジフェニルエーテル、3.4'-ビス(3-ブロモフェニル スルホニル) ジフェニルエーテル、4,4-ビス(4-ヨードフ ェニルスルホニル)ジフェニルエーテル、3,4'-ビス(4-ヨードフェニルスルホニル) ジフェニルエーテル、4,4'-ビス(3-ヨードフェニルスルホニル)ジフェニルエーテ ル、3,4'-ビス(3-ヨードフェニルスルホニル)ジフェニ ルエーテル、4,4'-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォ. -ニロキシフェニスルホニル) ジフェニルエーテル、3,4'-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル スルホニル) ジフェニルエーテル、4.4'-ビス(3-トリフ ルオロメチルスルフォニロキシフェニスルホニル) ジフ ェニルエーテル、3,4'-ビス(3-トリフルオロメチルスル フォニロキシフェニルスルホニル) ジフェニルエーテ ル、4,4 -ヒス(4-メチルスルフォニロキシフェニスルホ ニル) ジフェニルエーテル、3,4'-ビス(4-メチルスルフ オニロキシフェニルスルホニル)ジフェニルエーテル、 4,4'-ビス(3-メチルスルフォニロキシフェニスルホニ ル) ジフェニルエーテル、3,4'-ビス(3-メチルスルフォ ニロキシフェニルスルホニル)ジフェニルエーテル。

ェニルエーテルジカルボキシレート、3,4'-ビス(4-クロ ロフェニル)ジフェニルエーテルジカルボキシレート、 4,4'-ビス(3-クロロフェニル)ジフェニルエーテルジカ ルボキシレート、3,4'-ビス(3-クロロフェニル)ジフェ ニルエーテルジカルボキシレート、4,4'-ビス(4-ブロモ フェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、3, 4'-ビス(4-ブロモフェニル)ジフェニルエーテルジカル ボキシレート、4.4'-ビス(3-ブロモフェニル)ジフェニ ルエーテルジカルボキシレート、3,4'-ビス(3-ブロモフ 10 ェニル)ジフェニルエーテルジカルボキシレート、4.4'-ビス(4-ヨードフェニル)ジフェニルエーテルジカルボキ シレート、3,4'-ビス(4-ヨードフェニル)ジフェニルエ ーテルジカルボキシレート、4,4'-ビス(3-ヨードフェニ ル)ジフェニルエーテルジカルボキシレート、3.4'-ビス (3-ヨードフェニル)ジフェニルエーテルジカルボキシレ ート、4.4'-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキ シフェニル)ジフェニルエーテルジカルボキシレート、 3,4'-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェ ニル)ジフェニルエーテルジカルボキシレート、4.4'-ビ ス(3-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)ジ フェニルエーテルジカルボキシレート、3,4'-ビス(3-ト リフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)ジフェニ ルエーテルジカルボキシレート、4.4'-ビス(4-メチルス ルフォニロキシフェニル)ジフェニルエーテルジカルボ キシレート、3.4'-ビス(4-メチルスルフォニロキシフェ ニル)ジフェニルエーテルジカルボキシレート、4,4'-ビ ス(3-メチルスルフォニロキシフェニル)ジフェニルエー テルジカルボキシレート、3,4'-ビス(3-メチルスルフォ ニロキシフェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレ

10

【0030】(A2-5) 4,4'-ビス〔(4-クロロフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、3,4'-ビス〔(4-クロロフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(3-クロロフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、3,4'-ビス〔(3-クロロフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(4-ブロモフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニルエーテ

ル、3,4'-ビス〔(4-ブロモフェニル)-1.1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(3-ブロモフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、3,4'-ビス〔(3-ブロモフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(4-ヨードフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、3,4'-ビス〔(4-ヨードフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(3-ヨードフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピール〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(3-ヨードフェニル〕-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピート〕ジフェニルエーテル、3,4'-ビス〔(2-ヨードフェニル〕-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピート〕ジフェニルエーテル、3,4'-ビス〔(2-ヨードフェニル〕-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピート」ジフェニルエーテル、3,4'-ビス〔(2-ヨードフェニル〕-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピート」ジフェニルエーテル、3,4'-ビス〔(2-ヨードフェー

【0029】(A2-4) 4,4'-ビス(4-クロロフェニル)ジフ 50 ル〕ジフェニルエーテル、3,4'-ビス〔(3-ヨードフェニ

ル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニル エーテル、4,4'-ビス〔(4-トリフルオロメチルスルフォ ニロキシフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピ ル〕ジフェニルエーテル、3,4'-ビス〔(4-トリフルオロ メチルスルフォニロキシフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサ フルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス 〔(3-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニルエー テル、3.4'-ビス〔(3-トリフルオロメチルスルフォニロ キシフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル〕 10 ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(4-メチルスルフォニ ロキシフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピ ル〕ジフェニルエーテル、3,4'-ビス〔(4-メチルスルフ ォニロキシフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロ ピル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(3-メチルスル フォニロキシフェニル)-1.1.1.3.3.3-ヘキサフルオロプ ロピル〕ジフェニルエーテル、3,4'-ビス〔(3-メチルス ルフォニロキシフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ プロピル〕ジフェニルエーテル。

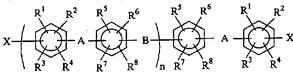
トラフルオロエチル〕ジフェニルエーテル、4,4'ビス 〔(3-クロロフェニル)テトラフルオロエチル〕ジフェニ ルエーテル、4.4'-ビス〔(4-クロロフェニル)へキサフ ルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(3-クロロフェニル)ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニル エーテル、4,4'ビス〔(4-クロロフェニル)オクタフルオ ロブチル) ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(3-クロロ フェニル)オクタフルオロブチル〕ジフェニルエーテ ル、4,4'-ビス〔(4-クロロフェニル)デカフルオロペン チル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(3-クロロフェ 30 ニル)デカフルオロペンチル〕ジフェニルエーテル、4, 4'-ビス〔(4-ブロモフェニル)テトラフルオロエチル〕 ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(3-ブロモフェニル) テトラフルオロエチル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビ ス〔(4-ブロモフェニル)ヘキサフルオロプロピル〕ジフ ェニルエーテル、4,4'-ビス((3-ブロモフェニル)へキ サフルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス ・〔(4-ブロモフェニル)オクタフルオロブチル〕ジフェニ ルエーテル、4.4'-ビス〔(3-ブロモフェニル)オクタフ ルオロブチル〕ジフェニルエーテル、4.4'-ビス〔(4-ブ 40 ロモフェニル) デカフルオロペンチル] ジフェニルエー テル、4,4'-ビス〔(3-ブロモフェニル)デカフルオロペ ンチル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(4-ヨードフ ェニル)テトラフルオロエチル〕ジフェニルエーテル、*

*4,4'-ビス((3-ヨードフェニル)テトラフルオロエチ ル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(4-ヨードフェニ ル)ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、4, 4'-ビス〔(3-ヨードフェニル)ヘキサフルオロプロピ ル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(4-ヨードフェニ ル)オクタフルオロブチル〕ジフェニルエーテル、4,4'-・ビス〔(3-ヨードフェニル)オクタフルオロブチル〕ジフ ェニルエーテル、4,4'-ビス〔(4-ヨードフェニル)デカ フルオロペンチル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス 〔(3-ヨードフェニル) デカフルオロペンチル〕 ジフェニ

12

ルエーテル、4,4'-ビス〔(4-トリフルオロメチルスルフ ォニロキシフェニル)テトラフルオロエチル) ジフェニ ルエーテル、4,4'-ビス〔(3-トリフルオロメチルスルフ ォニロキシフェニル)テトラフルオロエチル〕ジフェニ ルエーテル、4.4'-ビス〔(4-トリフルオロメチルスルフ ォニロキシフェニル)ヘキサフルオロプロピル]ジフェ ニルエーテル、4,4'-ビス〔(3-トリフルオロメチルスル フォニロキシフェニル)ヘキサフルオロプロピル〕ジフ ェニルエーテル、4,4'-ビス〔(4-トリフルオロメチルス 【0031】(A2-6) 4,4'-ビス〔(4-クロロフェニル)テ 20 ルフォニロキシフェニル)オクタフルオロブチル〕ジフ ェニルエーテル、4,4'-ビス〔(3-トリフルオロメチルス ルフォニロキシフェニル)オクタフルオロブチル〕ジフ ェニルエーテル、4,4'-ビス〔(4-トリフルオロメチルス ルフォニロキシフェニル)デカフルオロペンチル〕ジブ ェニルエーテル、4.4'-ビス〔(3-トリフルオロメチルス ルフォニロキシ) デカフルオロペンチル〕 ジフェニルエ ーテル、4,4'-ビス〔(4-メチルスルフォニロキシフェニ ル)テトラフルオロエチル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス ((3-メチルスルフォニロキシフェニル)テトラフル オロエチル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(4-メチ ルスルフォニロキシフェニル)ヘキサフルオロプロピ ル〕ジフェニルエーテル、4.4'-ビス〔(3-メチルスルフ ォニロキシフェニル)ヘキサフルオロプロピル〕ジフェ ニルエーテル、4,4'-ビス〔(4-メチルスルフォニロキシ フェニル)オクタフルオロブチル〕ジフェニルエーテ ル、4.4'-ビス〔(3-メチルスルフォニロキシフェニル) オクタフルオロブチル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビ ス〔(4-メチルスルフォニロキシフェニル)デカフルオロ ペンチル〕ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(3-メチル スルフォニロキシ) デカフルオロペンチル〕 ジフェニル

> エーテル。 [0032] 【化10】



 \cdots (a.2m)

※50※(一般式(a2m)中、Aは独立に式(a1-1m)で

13

定義したとおりの電子吸引性基であり、Bは独立に電子供与性の原子または2価の基であり、Xは独立に塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子であり、 $R^1 \sim R^8$ は、同一または異なり、水素原子、フッ素原子、アリル基、アルキル基またはフルオロアルキル基であり、nは2以上、好ましくは2 \sim 100、特に好ましくは2 \sim 80の整数である。)

【0033】上記一般式 (a2m) 中の電子供与性の原子または2価の基 (B) としては、-O-、-S-、-CH=CH-、 $-C\equiv C-$ 、

【0034】 【化11】



*【0035】 【化12】

$$-\sqrt{}$$

などが挙げられる。

【0036】上記モノマー(A3)の具体例としては、例えば、2,2-ビス[4-{4-(4-クロロベンゾイル)フェノキシ}フェニル]-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン、

10 ビス(4-{4-(4-クロロベンゾイル)フェノキシ}フェニル) スルホン、および下記の化学式で示されるものが挙げられる。

【0037】 【化13】

$$\begin{array}{c} * \\ \times \bigoplus so_{2} - \bigoplus o - \bigoplus co - \bigoplus o - \bigoplus so_{1} - \bigoplus x \\ \times \bigoplus so_{2} - \bigoplus o - \bigoplus co - \bigoplus co - \bigoplus so_{2} - \bigoplus x \\ \times \bigoplus so_{2} - \bigoplus o - \bigoplus so_{3} - \bigoplus o - \bigoplus so_{2} - \bigoplus x \\ \times \bigoplus so_{2} - \bigoplus o - \bigoplus co - \bigoplus co - \bigoplus co - \bigoplus x \\ \times \bigoplus co - \bigoplus o - \bigoplus co - \bigoplus co - \bigoplus co - \bigoplus x \\ \times \bigoplus co - \bigoplus o - \bigoplus co - \bigoplus co - \bigoplus co - \bigoplus x \\ \times \bigoplus so_{2} - \bigoplus o - \bigoplus co - \bigoplus co - \bigoplus co - \bigoplus so_{2} - \bigoplus x \\ \times \bigoplus so_{2} - \bigoplus o - \bigoplus so_{2} - \bigoplus o - \bigoplus so_{2} - \bigoplus x \\ \times \bigoplus so_{3} - \bigoplus o - \bigoplus so_{4} - \bigoplus co - \bigoplus so_{4} - \bigoplus x \\ \times \bigoplus so_{4} - \bigoplus o - \bigoplus so_{4} - \bigoplus co - \bigoplus so_{4} - \bigoplus x \\ \times \bigoplus so_{4} - \bigoplus o - \bigoplus co - \bigoplus co - \bigoplus so_{4} - \bigoplus x \\ \times \bigoplus so_{4} - \bigoplus o - \bigoplus co - \bigoplus co - \bigoplus co - \bigoplus co - \bigoplus so_{4} - \bigoplus x \\ \times \bigoplus co - \bigoplus o - \bigoplus co - \bigoplus x \\ \times \bigoplus co - \bigoplus x \\ \times \bigoplus co - \bigoplus x \\ \times \bigoplus co - \bigoplus x \\ \times \bigoplus co - \bigoplus x \\ \times \bigoplus co - \bigoplus x \\ \times \bigoplus co - \bigoplus co -$$

[上記式中、Xは一般式 (a2m) に関して定義したとおりである。]

【0038】本発明で使用できる上記モノマー(A3) としては、n=2で示される単量体の他、nが2よりも 大きな「オリゴマー」ないし「ポリマー」も使用でき ※ ※る。例として、分子末端に芳香族クロライドを有する構造のオリゴマーまたはポリマーの具体的構造式を挙げると下記のとおりである。

【0039】 【化14】

[0040]

[0041]

【 0 0 4 2 】 モノマー (A 3) は、例えば、電子供与性基が - O - の場合、電子吸引性基(A) で連結されたビスフェノールと、電子吸引性基で活性化されたフッ素、塩素等のハロゲン原子で置換された芳香族ジハライド化合物、例えば、4,4'-ジフルオロベンゾフェノン、4,4'-ジクロロベンゾフェノン、4,4'-クロロフルオロベンゾフェノン、ビス(4-フルオロフェニル)スルホン、ビス(4-フルオロフェニル)スルホン、ビス(3-ニトロ-4-クロロフェニル)スルホン、ビス(3-ニトロ-4-クロロフェニル)スルホン、2.6-ジフルオロベンゾニトリル、へキサフルオロベンゼン、デ★

★カフルオロビフェニル、2,5-ジフルオロベンゾフェノン、1,3-ビス(4-クロロベンゾイル)ベンゼンなどを反応させて合成することができる。好ましくは、活性芳香族ジハライドとして反応性の異なるハロゲン原子を一個づつ有するクロロフルオロ体を用いることであり、下記反40 応のように、フッ素原子が優先してフェノキシドと求核置換反応が起きるので、目的の活性化された末端クロロ体を得るのに好都合である。

【0043】 【化17】

17

【0044】(2)単位(B)を構成するモノマー 単位(B)を構成するモノマー(以下、モノマー(B) という)として、好ましくは、下記一般式(b1m)~ (b4m)で表されるものモノマー(以下、各々、順に 「モノマー(B1)」、「モノマー(B2)」、「モノ マー(B3)」、「モノマー(B4)」という)が挙げ られる。

[0045]

【化18】

$$\begin{array}{c}
R^{9} \\
R^{10} \\
R^{1}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
X \\
A \\
X
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{12} \\
R^{13} \\
R^{13}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
B \\
M
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
Z \\
R^{14} \\
R^{15}
\end{array}$$

... (b1m)

(一般式(b1m)中、Aは式(a1-1m)に関して定 義したとおりの電子吸引性基であり、Bは独立に式(a 2m) に関して定義したとおりの電子供与性の原子又は 基であり、Xは独立に塩素原子、臭素原子またはヨウ素 20 【0051】 原子であり、 $R^9 \sim R^{15}$ は、同一または異なり、水素原 子、フッ素原子、アリル基、アルキル基またはフルオロ アルキル基であり、Zはアリール基であり、mはO、1 または2の整数である。)

上記アルキル基またはフルオロアルキル基としては、式 (a1-1m)に関して定義したとおりである。イソプ ロピル基などの3級炭素を有するアルキル基であると、 架橋反応の際、架橋反応点として作用し、高度の架橋し た架橋高分子電解質がえられるので好ましい。

【0046】上記乙に係るアリール基としては、例え ば、フェニル基、ナフチル基、式:

[0047]

【化19】

(式中、R²⁵~R³³は式(b1m)に関してR⁹~R¹⁵ で定義したものと同じである。) で表されるビフェニリ 40 ル基が挙げられる。

【0048】モノマー(B1)としては、例えば、以下 の式で表される化合物が挙げられる。

[0049]

【化20】

1.8

$$\infty$$

〔式中、X及びZは一般式(b1m)で定義したとおり である。〕

【0050】さらに具体的には、モノマー(B1)の例 としては、2,4-ジクロロ-4'-フェノキシベンゾフェノ ン、4'-フェノキシフェニル2,5-ジクロロベンゾエー ト、4'-フェノキシフェニル2,4-ジクロロベンゾエー ト、また、下記式で表されるものが挙げられる。

【化21】

[0052] 【化22】

1 9
CH₃
CH

[0054] [化24] CI Br O

【0055】 【化25】 【0057】モノマー(B1)は、例えば、2,5-ジクロ ロ-4'-〔(4-フェノキシ)フェノキシ〕ベンゾフェノンを 例にとると、2,5-ジクロロ-4'-フルオロベンゾフェノン とp-フェノキシフェノールとを出発反応原料とし、これに炭酸カリウムを加えて反応性の高いフェノキシドに 変え、また反応溶媒として、ジメチルアセトアミド、トルエン、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド などの非プロトン系双極子極性溶媒などを用い、反応温度80~200℃で1~30時間反応させることにより、合成することができる。

【0058】

10 【化27】

$$X \xrightarrow{R^{19}} R^{18} \times X$$
 $X \xrightarrow{R^{19}} R^{20} \times (b \ 2 \ m)$

【0059】 【化28】

$$X \xrightarrow{R^{17}} R^{18} \xrightarrow{R^{18}} R^{21} \xrightarrow{R^{22}} X$$

【0060】 【化29】

(上記一般式(b2m)、(b3m)および(b4m)中、Xは独立に塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子または一〇S〇2Y(ここで、Yはアルキル基、ハロゲン化アルキル基またはアリール基を示す)であり、R¹⁷~R²⁴は、同一または異なり、水素原子、フッ素原子、アリル基、アルキル基またはフルオロアルキル基である。)【〇〇61】一般式(b2m)~(b4m)において、R¹⁷~R²⁴がアルキル基の場合は、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基などが挙げられ、フルオロアルキル基の場合は、トリフロオロメチル基、ペンタフルオロエチル基などが挙げられる。

【0062】上記モノマー(B2)の具体例としては、 次のものが挙げられる。p-ジクロロベンゼン、p-ジブ ロモベンゼン、p-ジョードベンゼン、p-ジメチルスル フォニロキシベンゼン、2,5-ジクロロトルエン、2,5-ジ ブロモトルエン、2,5-ジョードトルエン、2,5-ジメチル 30 スルフォニロキシベンゼン、2,5-ジクロロ-p-キシレ ン、2,5-ジブロモ-p-キシレン、2,5-ジョード-p-キシ レン、2,5-ジクロロベンゾトリフルオライド、2,5-ジブ ロモベンゾトリフルオライド、2.5-ジョードベンゾトリ フルオライド、1,4-ジクロロ-2,3,5,6-テトラフルオロ ベンゼン、1,4-ジブロモ-2,3,5,6-テトラフルオロベン ゼン、1,4-ジョード-2,3,5,6-テトラフルオロベンゼ ン。上記のなかでも好ましいものは、p-ジクロロベン ゼン、p-ジメチルスルフォニロキシベンゼン、2,5-ジ クロロトルエン、2,5-ジクロロベンゾトリフルオライド 40 である。

【0063】上記モノマー(B3)の具体例としては、次のものが挙げられる。4,4'-ジメチルスルフォニロキシビフェニル、4,4'-ジメチルスルフォニロキシー3,3'-ジプロペニルビフェニル、4,4'-ジブロモビフェニル、4,4'-ジメチルスルフォニロキシー3,3'-ジメチルビフェニル、4,4'-ジメチルスルフォニロキシー3,3'-ジフルオロビフェニル、4,4'-ジメチルスルフォニロキシー3,3',5,5'-テトラフルオロビフェニル、4,4'-ジブロモオクタフルオロビフェニル、4,4'-ジブロモオクタフルオロビフェニル、4,4'-ジブロモオクタフルオロビフェニル、4,4'-ジブロモオクタフルオロビフェニル、4,4'-ジブロモオクタフルオロビフェニル、4,4'-ジブロモオクタフルオロビフェニル、4,4'-ジブロモオクタフルオロビフェニル、4,4'-

メチルスルフォニロキシオクタフルオロビフェニル。上記のなかでも好ましいものは、4,4'-ジメチルスルフォニロキシビフェニル、4,4'-ジブロモビフェニル、4,4'-ジョードビフェニル、4,4'-ジメチルスルフォニロキシー3,3'-ジプロペニルビフェニルである。

【0064】上記モノマー(B4)の具体例としては、 次のものが挙げられる。m-ジクロロベンゼン、m-ジブ ロモベンゼン、m-ジョードベンゼン、m-ジメチルスル フォニロキシベンゼン、2,4-ジクロロトルエン、2,4-ジ 10 ブロモトルエン、2,4-ジョードトルエン、3,5-ジクロロ トルエン、3,5-ジブロモトルエン、3,5-ジヨードトルエ ン、2,6-ジクロロトルエン、2,6-ジブロモトルエン、2, 6-ジョードトルエン、3,5-ジメチルスルフォニロキシト ルエン、2,6-ジメチルスルフォニロキシトルエン、2,4-ジクロロベンゾトリフルオライド、2,4-ジブロモベンゾ トリフルオライド、2.4-ジョードベンゾトリフルオライ ド、3.5-ジクロロベンゾトリフルオライド、3.5-ジブロ モトリフルオライド、3,5-ジョードベンゾトリフルオラ イド、1,3-ジブロモ-2,4,5,6-テトラフルオロベンゼ ン。上記のなかでも好ましいものは、m-ジクロロベン ゼン、2,4-ジクロロトルエン、3,5-ジメチルスルフォニ ロキシトルエン、2,4-ジクロロベンゾトリフルオライド である。

【0065】本発明のポリアリーレン系共重合体の(b)単位を構成するためのモノマー(B)としては、上記モノマー(B1)~(B4)のなかでも、溶解性、高分子量化の面から、特に、ジクロロ安息香酸誘導体、例えば、2,5-ジクロロ-4'-フェノキシベンゾフェノン、2,4-ジクロロ-4'-フェノキシフェニルベンゾエート、2,4-ジクロロ-4'-フェノキシフェニルベンゾエートを使用することが好ましい。

【0066】(3)ポリアリーレン系共重合体の合成(a)主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物単位と、(b)主鎖に電子吸引性基を有しない芳香族化合物単位とを有するポリアリーレン系共重合体は、上記モノマー(A1)、モノマー(A2)およびモノマー(A3)からなる群から選ばれる少なくとも1種のモノマー(A)と、上記モノマー(B1)、モノマー(B2)、モノマー(B3)およびモノマー(B4)からなる群から選ばれる少なくとも1種のモノマー(B)とのカップリング反応により合成することができる。【0067】ポリアリーレン系共重合体を製造する際に使用される触媒は、遷移金属化合物を含む触媒系であり、この触ば系としては、(1)遷移金属作なとび配換なる。

使用される触媒は、遷移金属化合物を含む触媒系であり、この触媒系としては、(1)遷移金属塩および配位子となる化合物(以下、配位子成分という)、または配位子が配位された遷移金属錯体(銅塩を含む)、ならびに(2)還元剤を必須成分とし、さらに、重合速度を上げるために、「塩」を添加してもよい。

ニル、4.4'-ジブロモオクタフルオロビフェニル、4,4'- 50 【0068】ここで、遷移金属塩としては、塩化ニッケ

ル、臭化ニッケル、ヨウ化ニッケル、ニッケルアセチル アセトナートなどのニッケル化合物、塩化パラジウム、 臭化パラジウム、ヨウ化パラジウムなどのパラジウム化 合物、塩化鉄、臭化鉄、ヨウ化鉄などの鉄化合物、塩化 コバルト、臭化コバルト、ヨウ化コバルトなどのコバル ト化合物などが挙げられる。これらのうち特に、塩化ニ

【0069】また、配位子成分としては、トリフェニルホスフィン、2,2'-ビピリジン、1,5-シクロオクタジエン、1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパンなどが挙 10 げられるが、トリフェニルホスフィン、2,2'-ビピリジンが好ましい。上記配位子成分である化合物は、1種単独で、あるいは2種以上を併用することができる。

ッケル、臭化ニッケルなどが好ましい。

【0070】さらに、あらかじめ配位子が配位された遷移金属錯体としては、例えば、塩化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、臭化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、ヨウ化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、硝酸ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、硝酸ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、塩化ニッケル(2,2'-ビピリジン)、臭化ニッケル(2,2'-ビピリジン)、硝酸 20ニッケル(2,2'-ビピリジン)、ビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスフィン)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスファイト)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスファイト)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウムなどが挙げられるが、塩化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、塩化ニッケル(2,2'-ビピリジン)が好ましい。

【〇〇71】上記触媒系に使用することができる上記還 元剤としては、例えば、鉄、亜鉛、マンガン、アルミニ ウム、マグネシウム、ナトリウム、カルシウムなどを挙 30 げることできるが、亜鉛、マグネシウム、マンガンが好 ましい。これらの還元剤は、有機酸などの酸に接触させ ることにより、より活性化して用いることができる。 【0072】また、触媒系において使用することのでき る「塩」としては、フッ化ナトリウム、塩化ナトリウ ム、臭化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、硫酸ナトリウ ムなどのナトリウム化合物、フッ化カリウム、塩化カリ ウム、臭化カリウム、ヨウ化カリウム、硫酸カリウムな どのカリウム化合物、フッ化テトラエチルアンモニウ ム、塩化テトラエチルアンモニウム、臭化テトラエチル 40 アンモニウム、ヨウ化テトラエチルアンモニウム、硫酸 テトラエチルアンモニウムなどのアンモニウム化合物な どが挙げられるが、臭化ナトリウム、ヨウ化ナトリウ ム、臭化カリウム、臭化テトラエチルアンモニウム、ヨ ウ化テトラエチルアンモニウムが好ましい。

【0073】触媒系における各成分の使用割合は、遷移金属塩または遷移金属錯体が、上記モノマーの総計1モルに対し、通常、0.0001~10モル、好ましくは0.01~0.

ルに対し、通常、0.0001~10モル、好ましくは0.01~0.5モルである。0.0001モル未満では、重合反応が十分に進行せず、一方、10モルを超えると、分子量が低下する

24

という問題がある。

【0074】触媒系において、遷移金属塩および配位子成分を用いる場合、この配位子成分の使用割合は、遷移金属塩1モルに対し、通常、0.1~100モル、好ましくは1~10モルである。0.1モル未満では、触媒活性が不十分となり、一方、100モルを超えると、分子量が低下するという問題がある。

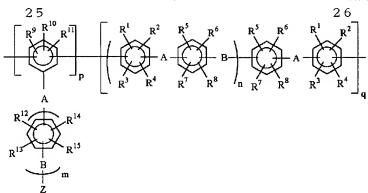
【0075】また、触媒系における還元剤の使用割合は、上記モノマーの総計1モルに対し、通常、0.1~100モル、好ましくは1~10モルである。0.1モル未満では、重合が十分進行せず、一方、100モルを超えると、得られる重合体の精製が困難になるという問題がある。【0076】さらに、触媒系に「塩」を使用する場合、その使用割合は、上記モノマーの総計1モルに対し、通常、0.001~100モル、好ましくは0.01~1モルである。0.001モル未満では、重合速度を上げる効果が不十分であり、一方、100モルを超えると、得られる重合体の精製が困難となるという問題がある。

【0077】ポリアリーレン系共重合体の合成のため使用することのできる重合溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、ジメチルスルホキシド、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン、アーブチロラクトン、アーブチロラクタムなどが挙げられ、テトラヒドロフラン、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドンが好ましい。これらの重合溶媒は、十分に乾燥してから用いることが好ましい。重合溶媒中における上記モノマーの総計の濃度は、通常、1~90重量%、好ましくは5~40重量%である。

【0078】また、ポリアリーレン系共重合体を重合する際の重合温度は、通常、0~200℃、好ましくは50~120℃である。また、重合時間は、通常、0.5~100時間、好ましくは1~40時間である。

【0079】ここで、例えば、モノマー(A3)とモノマー(B1)を用いて上記の条件で重合させることにより、一般式:

【0080】 【化30】



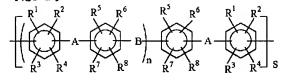
(ここで、A, B, Z, $R^1 \sim R^{15}$, m及びnは上述の とおりであり、p及びqは独立にそれぞれの繰返し単位 の数を示し、p/qの比(即ち、上記二つの繰返し単位 のモル比)は99/ $1\sim20/80$ である。)で表される共重 合体が得られる。

【0081】ポリアリーレン系共重合体の構造は、例えば、赤外線吸収スペクトルによって、 $1,230\sim1,250\,\mathrm{cm}$ $^{-1}$ のC-O-C吸収、 $1,640\sim1,660\,\mathrm{cm}$ $^{-1}$ のC-O0 $^{-1}$ 0

【0082】(4)ポリアリーレン系重合体の合成 上記ポリアリーレン系共重合体の場合と同様な方法・条件によって、モノマー(A3)のみを原料として用いて、下記構造式(A)のポリアリーレン系重合体を合成することができる。

[0083]

【化31】



 \cdots (A) (ここで、A, B, Z, $R^1 \sim R^8$, 及びnは上述のとおりであり、sは繰返し単位の数を示す。)

【0084】(5)ポリアリーレン系(共)重合体のスルホン化

次に、スルホン酸基を有する(共)重合体は、スルホン酸基を有しない上記(共)重合体に、スルホン化剤を用 40い、常法によりスルホン酸基を導入することにより得ることができる。

【0085】スルホン酸基を導入する方法としては、例えば、上記スルホン酸基を有しない共重合体を、無水硫酸、発煙硫酸、クロルスルホン酸、硫酸、亜硫酸水素ナトリウムなどの公知のスルホン化剤を用いて、無溶剤下、あるいは溶剤存在下で、公知の条件でスルホン化することができる。

【0086】溶剤としては、例えばn-ヘキサンなどの 炭化水素溶剤、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどの*50

*エーテル系溶剤、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドのような非プロトン系極性溶剤のほか、テトラクロロエタン、ジクロロエタン、クロロホルム、塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素などが挙げられる。反応温度は特に制限はないが、通常、-50~200℃、好ましくは-10~100℃である。また、反応時間は、通常、0.5~1,000時間、好ましくは1~200時間である。

20 【0087】このようにして得られる、本発明のスルホン酸基含有(共)重合体中の、スルホン酸基量は、0.5~3ミリグラム当量/g、好ましくは0.8~2.8ミリグラム当量/gである。0.5ミリグラム当量/g未満では、プロトン伝導性が上がらず、一方3ミリグラム当量/gを超えると、親水性が向上し、水溶性ボリマーとなってしまうか、また水溶性に至らずとも耐久性が低下する。【0088】上記のスルホン酸基量は、モノマー(A)とモノマー(B)の使用割合、さらにモノマー(A)およびモノマー(B)の種類、組合せを変えることによ30 り、容易に調整することができる。

【0089】また、このようにして得られるスルホン酸基含有ポリアリーレン系(共)重合体のスルホン化前の前駆体のポリマーの分子量は、ポリスチレン換算重量平均分子量で、10×10³~1,000×10³、好ましくは20×10³~800×10³である。10×10³未満では、成形フィルムにクラックが発生するなど、塗膜性が不十分であり、また強度的性質にも問題がある。一方、1,000×10³を超えると、溶解性が不十分となり、また溶液粘度が高く、加工性が不良になるなどの問題がある。

【0090】なお、スルホン酸基含有ポリアリーレン系(共)重合体の構造は、赤外線吸収スペクトルによって、1,030~1,045cm⁻¹、1,160~1,190cm⁻¹のS=〇吸収、1,130~1,250cm⁻¹のC-〇一C吸収、1,640~1,660cm⁻¹のC=〇吸収などにより確認でき、これらの組成比は、スルホン酸の中和滴定や、元素分析により知ることができる。また、核磁気共鳴スペクトル(¹ HーNMR)により、6.8~8.0ppmの芳香族プロトンのピークから、その構造を確認することができる。

【0091】また、本発明に係るスルホン酸基含有 (共) 重合体とともに、硫酸、リン酸などの無機酸、カ ルボン酸等の有機酸、適量の水などを併用しても良い。 【0092】2. [プロトン伝導性ポリマーの存在下に おける架橋性モノマーの重合]

27

プロトン伝導性ポリマーの存在下において架橋性モノマ ーをラジカル重合反応させることにより、本発明に係る 架橋高分子電解質を得ることができる。プロトン伝導性 ポリマーと架橋性モノマーの使用割合は、99.9~50/0. 1~50重量比、好ましくは 99.9~70/0.1~30である。 【0093】重合反応としては、熱、光または還元剤の 作用によりラジカルを発生するラジカル重合開始剤の存 10 在下に、架橋性モノマーを反応させることがより好まし 11.

【0094】このラジカル重合開始剤としては、有機過 酸化物、アゾビス系ラジカル重合開始剤が挙げられる。 有機過酸化物を用いると、より架橋反応が進行するので 好ましい。

【0095】有機過酸化物の具体例としては、(1) アセ チルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、イソ ブチロイルパーオキサイド、2,4-ジクロロベンゾイルパ ーオキサイド、3,5,5-トリメチルヘキサノイルパーオキ 20 サイド、オクタノイルパーオキサオド、ラウロイルパー オキサイド、ステアロイルパーオキサイド、コハク酸パ ーオキサイド、m-トルオイルベンゾイルパーオキサイ ド、などのジアシルパーオキサイド類:

【0096】(2) メチルエチルケトンパーオキサイド、 シクロヘキサノンパーオキサイド、メチルシクロヘキサ ノンパーオキサイド、アセチルアセトンパーオキサイド などのケトンパーオキサイド類:

【0097】(3) 過酸化水素、t-ブチルハイドロパー ンハイドロパーオキサイド、ジイソプロピルベンゼンハ イドロパーオキサイド、1,1,3,3-テトラメチルブチルハ イドロパーオキサイド、t-ヘキシルハイドロパーオキサ イドなどのハイドロパーオキサイド類:

【0098】(4) ジ-t-ブチルパーオキサイド、ジクミ ルパーオキサイド、ジラウリルパーオキサイド、 α , α -ビス(t-ブチルパーオキシ)ジイソプロピルベン、2.5-ジメチル-2,5-ビス(t-ブチルパーオキシ)ヘキサン、t-ブチルクミルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5-ビス (t-ブチルパーオキシ)ヘキシン-3などのジアルキルパー 40 オキサイド類:

【0099】(5) t-ブチルパーオキシアセテート、t-ブチルパーオキシピバレート、t-ヘキシルパーオキシピ バレート、1,1,3,3-テトラメチルブチルパーオキシ2-エ チルヘキサノエート、2,5-ジメチル-2,5-ビス(2-エチル ヘキサノイルパーオキシ)ヘキサン、1-シクロヘキシル-1-メチルエチルパーオキシ2-エチルヘキサノエート、t-ヘキシルパーオキシ2-エチルヘキサノエート、t-ブチル パーオキシ2-エチルヘキサノエート、t-ブチルパーオキ

モノカーボネート、t-ブチルパーオキシイソプロピルモ ノカーボネート、t-ブチルパーオキシ2-エチルヘキシル モノカーボネート、t-ブチルパーオキシアリルモノカー ボネート、t-ブチルパーオキシマレエート、t-ブチルパ ーオキシ3,5,5-トリメチルヘキサノエート、t-ブチルパ ーオキシラウレート、2,5-ジメチル-2,5-ビス(m-トルオ イルパーオキシ)ヘキサン、 α , α ービス(ネオデカノイ ルパーオキシ)ジイソプロピルベンゼン、クミルパーオ キシネオデカノエート、1,1,3,3-テトラメチルブチルパ ーオキシネオデカノエート、1-シクロヘキシル-1-メチ ルエチルパーオキシネオデカノエート、t-ヘキシルパー オキシネオデカノエート、t-ブチルパーオキシネオドデ カノエート、t-ブチルパーオキシベンゾエート、t-ヘキ シルパーオキシベンゾエート、ビス(t-ブチルパーオキ シ)イソフタレート、2.5-ジメチル-2,5-ビス(ベンゾイ ルパーオキシ)ヘキサン、t-ブチルパーオキシロ-トルオ イルベンゾエート、3,3',4,4'-テトラ(t-ブチルパーオ キシカルボニル)ベンゾフェノンなどのパーオキシエス テル類;

【0100】(6) 1,1-ビス(t-ヘキシルパーオキシ)3,3, 5-トリメチルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ヘキシルパ ーオキシ)シクロヘキサン、1.1-ビス(t-ブチルパーオキ シ)3,3,5-トリメチルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチ ルパーオキシ)シクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパー オキシ)シクロドデカン、2,2-ビス(t-ブチルパーオキ シ)ブタン、n-ブチル4,4-ビス(t-ブチルパーオキシ)バ レレート、2,2-ビス(4,4-ジ-t-ブチルパーオキシシクロ ヘキシル)プロパンなどのパーオキシケタール類;

【0101】(7) ジ-n-プロピルパーオキシジカーボネ オキサイド、クメンハイドロパーオキサイド、p-メンタ 30 ート、ジソプロピルパーオキシジカーボネート、ビス(4 -t-ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート、 ジ-2-エトキシエチルパーオキシジカーボネート、ジ-2-エチルヘキシルパーオキシジカーボネート、ジ-2-メト キシブチルパーオキシジカーボネート、ジ(3-メチル-3-メトキシブチル)パーオキシジカーボネートなどのパー オキシジカーボネート類、その他、t-ブチルトリメチル シリルパーオキサイドなどが挙げられる。

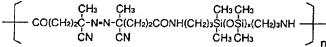
【0102】アゾビス系ラジカル重合開始剤の具体例と しては、アゾビスイソブチロニトリル、アゾビスイソバ レロニトリル、2,2'-アゾビス(4-メトキシ-2,4-ジメチ ルバレロニトリル)、2,2'-アゾビス(2,4-ジメチルバレ ロニトリル)、2,2'-アゾビス(2-メチルブチロニトリ ル)、1,1'-アゾビス(シクロヘキサン-1-カルボニトリ ル)、2-(カルバモイルアゾ)イソブチロニトリル、2,2'-アゾビス[2-メチル-N-{1,1-ビス(ヒドロキシメチル)-2-ヒドロキシエチル プロピオンアミド]、2.2'-アゾビス (2-メチル-N-(2-(1-ヒドロキシブチル))プロピオンアミ ド]、2,2'-アゾビス[2-メチル-N-(2-ヒドロキシエチル) -プロピオンアミド]、2,2'-アゾビス[N-(2-プロペニル) シイソブチレート、t-ヘキシルパーオキシイソプロピル 50 -2-メチルプロピオンアミド]、2,2'-アゾビス(N-ブチル

-2-メチルプロピオンアミド)、2,2'-アゾビス(N-シクロ * ヘキシル-2-メチルプロピオンアミド)、2,2'-アゾビス [2-(5-メチル-2-イミダゾリン-2-イル)プロパン]ジハイドロクロライド、2,2'-アゾビス[2-(2-イミダゾリン-2-イル)プロパン]ジハイドロクロライド、2,2'-アゾビス [2-(2-イミダゾリン-2-イル)プロパン]ジサルフェート・ジハイドレート、2,2'-アゾビス[2-(3,4,5,6-テトラヒドロピリミジン-2-イル)プロパン]ジハイドロクロライド、2,2'-アゾビス[2-(1-(2-ヒドロキシエチル)-2-イミダゾリン-2-イル)プロパン]ジハイドロクロライド、*10

*2,2'-アゾビス[2-(2-イミダゾリン-2-イル)プロパン]、 2,2'-アゾビス(2-メチルプロピオンアミジン)ジハイドロクロライド、2,2'-アゾビス[N-(2-カルボキシエチル)-2-メチル-プロピオンアミジン]、2,2'-アゾビス(2-メチルプロピオンアミドキシム)、ジメチル2,2'-アゾビスブチレート、4,4'-アゾビス(4-シアノペンタノイックアシッド)、2,2'-アゾビス(2,4,4-トリメチルペンタン)および下記式で表される重合体などが挙げられる。

[0103]

インジハイドロクロライド、*10 【化32】



(分子星:約70,000~90,000)

★【化34】

CH3 CH3 CH3

CO(CH2)2COO(CH2CH2O)x

CN CN

(分子量:約25,000~40,000)なお、過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウムなどの過硫酸塩類もラジカル重合開始剤として用いることができる。

【0107】1分子中に2つ以上のラジカル重合性基を有するモノマーの重合性基の数は、好ましくは3以上、更に好ましくは4以上、特に好ましくは5ないし6である。1分子中に2つ以上のラジカル重合性基を有するモノマーとしては、例えば、ジペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ボリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ボリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,4-ブタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリオキシエチル(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリオキシエチル(メタ)アクリレート、トリス・トリス(2-トドキシエチー50

◆ル)イソシアヌレートトリ(メタ)アクリレート、トリス (2-ヒドロキシエチル)イソシアヌレートジ(メタ)アクリレート、ビス(ヒドロキシメチル)トリシクロデカンジ (メタ)アクリレート、ビスフェノールAのエチレンオキサイドまたはプロピレンオキサイドの付加体であるジオールのジ(メタ)アクリレート、水添ビスフェノールAのエチレンオキサイドまたはプロピレンオキサイドの付加 体であるジオールのジ(メタ)アクリレート、ビスフェノールAのジグリシジルエーテルにヒドロキシ(メタ)アクリレート等のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを付加させたエボキシ(メタ)アクリレート、ボリオキシアルキレン化ビスフェノールAのジ(メタ)アクリレート、p-またはm-ジビニルベンゼン、トリエチレングリコールジビニルエーテルなどが挙げられる。

タンジオールジ(メタ)アクリレート、1,6-ヘキサンジオ 【0108】1分子中に2つ以上のラジカル重合性基を ールジ(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールジ 有するモノマーの市販品としては、例えば、KAYAR(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリオキ AD-DPHA、KAYARAD R-604、DPCシエチル(メタ)アクリレート、トリス(2-ヒドキシエチ $\spadesuit50$ A-20、-30、-60、-120、HX-620、

D-310、D-330(以上、日本化薬(株)製)ユ ピマーUV SA1002、SA2007(以上、三菱 化学(株)製)、ビスコート #195、#230、# 215、#260、#335HP、#295、#30 0、#700(大阪有機化学工業(株)製)、ライトア クリレート 4EG-A、9EG-A、NP-A、DC P-A, BP-4EA, BP-4PA, PE-3A, P E-4A、DPE-6A(以上、共栄社化学(株) 製)、アロニックス M-208、M-210、M-2 15、M-220、M-240、M-305、M-30 10 出した。 9、M-315、M-325(以上、東亜合成(株) 製) などが挙げられる。

【0109】本発明に係る架橋高分子電解質の製造方法 において、電解質膜(プロトン伝導膜)を得るには、例 えば、スルホン酸基含有共重合体を溶剤に溶解したの ち、多官能ラジカル重合性モノマーおよびラジカル重合 開始剤を混合したものを、キャスティングによりフィル ム状に成形した後に加熱して、溶剤を揮散するととも に、その後より高い温度でラジカル重合・架橋反応させ ればよい。得られた架橋フィルムは、もはや溶剤には不 20 溶性ないし難溶性のものであり、電解質膜(プロトン伝 導膜)として用いることができる。

【0110】上記、キャスティング法における溶剤とし ては、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、 N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルスルホキシドなどの 非プロトン系極性溶剤などが挙げられる。これらの溶剤 にはさらにメタノールなどのアルコール系溶剤が混合さ れていてもよい。

【0111】本発明の製造方法で得られる架橋高分子電 解質は、膜状体として、例えば一次電池用電解質、二次 30 電池用電解質、燃料電池用高分子固体電解質、表示素 子、各種センサー、信号伝達媒体、固体コンデンサー、 イオン交換膜などに利用可能なプロトン伝導性膜に利用 可能である。

[0112]

【実施例】以下、実施例を挙げ本発明をさらに具体的に 説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるもので はない。

【0113】なお、実施例中の各種の測定項目は、下記 のようにして求めた。

[重量平均分子量] スルホン化前の前駆体ポリマーの重 量平均分子量は、溶媒にテトラヒドロフラン(THF) を用い、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(G PC)によって、ポリスチレン換算の分子量を求めた。 【0114】[スルホン酸基の量]得られたスルホン化 ポリマーの水洗水がpH4~6になるまで洗浄して、フ リーの残存している酸を除去後、十分に水洗し、乾燥 後、所定量を秤量し、THF/水の混合溶剤に溶解し、 フェノールフタレインを指示薬とし、NaOHの標準液 ム当量/g)を求めた。

【0115】 [プロトン伝導度の測定] 100%相対湿度 下に置かれた直径13mmのフィルム状試料を、白金電極 に挟み、密閉セルに封入し、インピーダンスアナライザ - (HYP4192A)を用いて、周波数5~13MH z、印加電圧12m V、温度20℃、50℃、100℃にてセル のインピーダンスの絶対値と位相角を測定した。得られ たデータは、コンピュータを用いて発振レベル12mVに て複素インピーダンス測定を行い、プロトン伝導率を算

32

【0116】[引っ張り強度、引っ張り伸度およびヤン グ率の測定]引っ張り強度、引っ張り伸度およびヤング 率は、得られたフィルムの室温での引張試験によって測 定した。

【0117】[フェントン試験]3重量%の過酸化水素 に硫酸鉄・七水和物を鉄イオンの濃度が20ppmになる ようにフェントン試薬を調製した。250ccのポリエチ レン製溶液に200gのフェントン試薬を採取し、3 c m ×4 c m、膜厚=55μmに切削した高分子電解膜を投入 後、密栓後、45℃の恒温水槽に浸漬させ、150hのフェ ントン試験を行った。フェントン試験後、フィルムを取 り出し、イオン交換水にて水洗後、25℃・50%RH・12 h状態調製を行い、各種物性測定を行った。フェントン 試験における重量保持率は、下記の数式により算出し

フェントン試験における重量保持率(%)=フェントン 試験後のフィルム重量/フェントン試験前のフィルム重 量×100

【0118】-合成例1-[スルホン化ポリマー1の合

(オリゴマーの合成) 撹拌機、温度計、冷却管、Dean-S tark管、窒素導入の三方コックをとりつけた1Lの三つ 口のフラスコに、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1, 1,1,3,3,3- ヘキサフルオロプロパン(ビスフェノールA F) 67.3g(0.20モル)、4,4'-ジクロロベンゾフェノン (4,4'-DCBP) 60.3g(0.24モル)、炭酸カリウム 71. 9g(0.52モル)、N,N-ジメチルアセトアミド(DMA c) 300mL、トルエン150mLをとり、オイルバス中、 窒素雰囲気下で加熱し撹拌下 130℃で反応させた。反応 により生成する水をトルエンと共沸させ、Dean-Stark管 で系外に除去しながら反応させると、約3時間で水の生 成がほとんど認められなくなった。反応温度を 130℃か ら徐々に150℃まで上げた。その後、反応温度を徐々に1 50℃まで上げながら大部分のトルエンを除去し、150 ℃ で10時間反応を続けた後、4,4'-DCBP 10.0g (0.04 0モル)を加え、さらに5時間反応した。得られた反応液 を放冷後、副生した無機化合物の沈殿物を沪過除去し、 沪液を4 Lのメタノール中に投入した。沈殿した生成物 を沪別、回収し乾燥後、テトラヒドロフラン 300mLに にて滴定し、中和点から、スルホン酸基の量(ミリグラ 50 溶解した。これをメタノール4 Lに再沈殿し、目的の化 合物95g(収率85%)を得た。

【0119】得られた重合体のGPC(THF溶媒)で求めたポリスチレン換算の数平均分子量は4,200、重量平均分子量は8,300であった。また、得られた重合体はTHF、NMP、DMAc、スルホランなどに可溶で、T*

...(I)

で表される構造を有すると推定され、該構造と上記の数 10 平均分子量とからみて、nの平均値は 7.8と求められた。

【0122】(ポリアリーレン系共重合体の合成)前記 式(I)のオリゴマー28.4g(2.87mmo1)、2,5-ジク ロロ-4'-(4-フェノキシ)フェノキシベンゾフェノン(D CPPB) 29.2g(67.1mmol)、ビス(トリフェニ ルホスフィン)ニッケルジクロリド1.37g(2.1mmo 1)、よう化ナトリウム1.36g(9.07mmol)、トリ ·フェニルホスフィン7.34g(28.0mmol)、亜鉛末1 1.0g(168mmol)をフラスコにとり、乾燥窒素置換 20 した。N-メチルピロリドン(NMP)130mlを加え、 80℃に加熱し、4時間攪拌し、重合をおこなった。重合 溶液をTHFで希釈し、塩酸/メタノールで凝固回収 し、メタノール洗滌を繰り返し、THFで溶解、メタノ ールへ再沈殿による精製し、沪集したポリマーを真空乾 燥し目的の共重合体50.7g(96%)を得た。 GPC (THF)で求めたポリスチレン換算の数平均分子量は 40,000、重量平均分子量は145,000であった。

【0123】(スルホン化ポリマー1の調製)上記で得た共重合体25gを500mlのセパラブルフラスコに入れ、96%硫酸250mlを加え、窒素気流下で24時間攪拌した。得られた溶液を大量のイオン交換水の中に注ぎ入れ、ポリマーを沈殿させた。洗浄水のpHが中性になるまでポリマーの洗浄を繰り返した。乾燥して、29g(96%)のスルホン化ポリマーを得た。スルホン化ポリマーのスルホン化当量は、1.70ミリグラム当量/gであった。

【0124】-合成例2-[スルホン化ポリマー2の合成]

2,5-ジクロロ-4'-フェノキシベンゾフェノン193.5g(5 40 40mmol)、4,4'-ジクロロベンゾフェノン15.1g(6 0mmol)、ヨウ化ナトリウム11.7g(78mmol)、ビストリフェニルホスフィンニッケルジクロライド11.8g(1.8mmol)、トリフェニルホスフィン63.0g(240mmol)、亜鉛94.1g(1.44mol)を環流管、三方コックを取り付けた三口フラスコに入れ、70℃のオイルバスにつけ、窒素置換後、窒素雰囲気下にN-メチル-2-ピロリドン1,000ml加え、反応を開始した。20時間反応後、N-メチル-2-ピロリドン500mlで希釈し、1:10塩酸/メタノール溶液に重合反応液を注ぎ、※50

* gは110℃、熱分解温度は498℃であった。

【0120】得られたオリゴマーは式(I):

【0125】上記得られたポリマー150gに対し、濃硫酸1,500mlを加え室温で24時間、攪拌しスルホン化反応を行った。反応後、大量の純水中に注ぎ、スルホン化ポリマーを析出させた。pH7になるまでポリマーの水洗浄を続け、ろ過後、スルホン化ポリマーを回収し、90℃で真空乾燥した。スルホン化ポリマーの収量は、179gであった。スルホン化ポリマーのスルホン化当量は、2.45ミリグラム当量/gであった。

【0126】-実施例1-

したが膨潤は観察されなかった。

上記合成例1で得られたスルホン化ポリマー1の10%N MP溶液900重量部(スルホン化ポリマー1 固形分量90重量部)、架橋性モノマーとしてジペンタエリスリトールペキサアクリレートとジペンタエリスリトールペンタアクリレートとの混合物(商品名: KAYARAD-DPHA(日本化薬(株)製))10重量部および過酸化物(ジーセブチルパーオキサイド)1部を混合して均一な30 NMP溶液を調整した。

【0127】ドクターブレードを用い、このNMP溶液をガラス基板上に55μmの厚さで塗布した後、70℃にて1時間オーブンを用い予備乾燥させ、塗膜をガラス基板から剥がした。フィルムを耐熱テープでアルミ板上に固定化後、さらに170℃で1時間加熱処理し、架橋性モノマーの重合・架橋反応を行い目的とする架橋高分子電解膜を得た。次いで、塗膜中に残存するNMPを完全に除去するため、蒸留水中に室温で7日間浸漬させ、残存NMPを除去した。その後、フィルム乾燥を行った。

【0128】このフィルム状架橋高分子電解質について N-メチルピロリドン (NMP) への不溶分を測定した ところ、95重量%であり、高度に架橋されている構造の フィルムであることがわかった。フィルムを25℃・50% RH12時間状態調製後、各種物性測定を行った。結果を表1に示す。当該フィルムは、フェントン試験の前後で、フィルム劣化することなく、高いプロトン伝導性、高い引っ張り強度を維持し、極めて物性バランスの優れるものであった。

【0129】-比較例1-

上記実施例1において、重合・架橋を行わないで、スル

ホン化ポリマー1を100重量部用いて、フィルムを得た。各種物性測定結果を表1に示す。

【·O 1 3 0】-実施例2-

実施例1において、スルホン化ポリマー1に代えて、合成例2で得たするスルホン化ポリマー2を用いること以外は、実施例1と同様にしてフィルム状架橋高分子電解質を得た。各種物性測定結果を表1に示す。

*【0131】-比較例2-

上記実施例2において、重合・架橋を行わないで、スルホン化ポリマー2を100重量部用いて、フィルムを得た。各種物性測定結果を表1に示す。

[0132]

【表1】

[実施例・比較例]

[実施例・比較例]								
		実施例1	爽施例2	比較例1	比較例2			
ポリマー成分	スルホン化ポリマー1(重量部)	90		100				
	スルホン化ポリマー2(重量部)		90		100			
モノマー	KAYARAD-DPHA(日本化薬製)(重量部)	10	10	-				
重合開始剤	ジーtーブチルパーオキサイド(重量部)	1	1	-	-			
[耐久試験データ]								
フェントン試験前	重量保持率(%)	100	100	100	100			
	NMP不溶部(%)	95	96	0	0			
	イオン交換容量	1.7	2.43	2.33	2.41			
	プロトン伝導度(S/cm)at85℃、90%RH	0.145	0,178	0.173	0.175			
(架橋反応後)	重量平均分子量	276000	487000	458000	471000			
	数平均分子量	67000	75200	74500	77300			
<u>'</u>	ヤング率(MPa)	2510	3250	3050	3080			
	引っ張り強度(MPa)	67	102	88	89			
	引っ張り伸び(%)	45	5,1	4.7	5.5			
フェントン試験後	重量保持率(%)	97	100	0	0			
	NMP不溶部(%)	93	92	塗 測	塗 測			
	イオン交換容量	1.7	2.45	膜定	膜定			
	プロトン伝導度(S/cm)at85℃、90%RH	0.147	0.176	溶 不	溶 不			
	重量平均分子量	274000	482000	解能	解能			
	数平均分子量	65800	74900	ο.	σ 。			
	ヤング軍(MPa)	2490	3160	た	t:			
	引っ張り強度(MPa)	68	92	め	ል ን			
	引っ張り伸び(%)	55	5.1		_			

[0133]

【発明の効果】本発明によれば、本来必要とされる高いプロトン伝導性を維持し、かつ耐久性に極めて優れる架橋高分子電解質を提供することが可能になった。そして、この架橋高分子電解質は、プロトン伝導性ボリマーが架橋性モノマーにより高度に架橋されているため、特※

※に高耐久性の燃料電池のプロトン伝導膜として好適に使用することができる。また、このものは、一次電池用電解質、二次電池用電解質、表示素子、各種センサー、信30号伝達媒体、固体コンデンサー、イオン交換膜などの伝導膜として利用可能であり、この工業的意義は極めて大である。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

HO1M 8/10

HO1M 8/10

Fターム(参考) 4J011 PA83 PA90 PA94 PC02 4J026 AC36 BA28 GA02 5G301 CD01 5H026 AA06 CX05 EE17 EE18

8/27/07, EAST Version: 2.1.0.14